

SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)

次世代パワーエレクトロニクス(どこでもパワエレ機器で豊かな省エネ社会)

研究開発計画(案)

(平成26年3月27日版)

内閣府

研究開発計画の概要

1. 意義・目標等

今後の省エネルギー化のためのキーテクノロジーであるパワーエレクトロニクスの世界市場規模は、2030年には20兆円と大きな成長が見込まれている。日本企業は、Si-IGBT モジュールなど特定のデバイスでは高い市場シェアを有するものの、Siを性能で凌駕する次世代材料のSiCでは欧米企業に一部先行されるなど、この重要領域における競争環境は厳しさを増している。また欧米では、実用化に向けた緊密な産学開発体制が構築されており、中国、韓国、台湾でもSiCパワーデバイスの国家プロジェクトを立ち上げ、日本を猛追している。このような状況に鑑み、本プロジェクトではSiCやGaN等の次世代材料を中心に、次世代パワーエレクトロニクスの適用用途の拡大や普及拡大、性能向上を図り、今後一層の産業競争力の強化及び省エネルギー化を推進することを目標とする。

2. 研究内容

- 研究開発項目Ⅰ SiCに関する拠点型共通基盤技術開発（高耐圧化、小型化、低損失化、信頼性向上）
- 研究開発項目Ⅱ GaNに関する拠点型共通基盤技術開発（ウエハ及びデバイスの高品質化）
- 研究開発項目Ⅲ 次世代パワーモジュールの応用に関する基盤研究開発（回路、使いこなし技術）
- 研究開発項目Ⅳ 将来のパワーエレクトロニクスを支える基盤研究開発（新材料、新構造等）

3. 実施体制

研究開発項目Ⅰ、Ⅱは、中心となる研究機関のもと、関係機関がネットワークを構築する等により、目標達成に向けて効率的に研究開発を推進する「研究開発拠点」を設置し、ウエハ、デバイス等の階層相互のフィードバックを構築して、関連の研究者等の人材育成も達成する。研究開発項目Ⅲは、必要に応じて他の研究開発項目と連携して実施するものとする。研究開発項目Ⅳは、10～15年後の実用化を目指し、産学の新しい知を結集する。なお、研究開発項目Ⅳでは、中間評価の結果に基づいて、プロジェクトの後半は研究開発テーマを絞り込んで実施する。また、本プロジェクトの成果は、経済産業省の事業への橋渡しを行う等により、早期の実用化・事業化へと導いてゆく。

4. 知財管理

知財委員会を設置し、発明者や産業化を進める者のインセンティブを確保し、かつ、国民の利益の増大を図るべく、適切な知財管理を行う。

5. 評価

ガバニングボードによる毎年度末の評価の前に、プログラムディレクター等による自己点検を実施し、自律的にも改善可能な体制とする。

6. 出口戦略

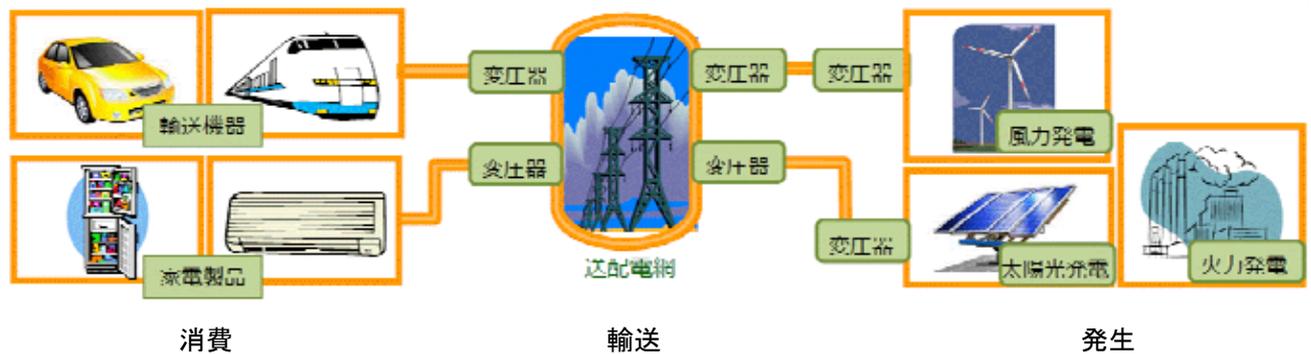
- (1) 戦略及びシナリオの検討・策定
- (2) 標準化・性能認証制度や省エネトップランナー基準等による成果普及

1. 意義・目標等

(1) 背景・国内外の状況

パワーエレクトロニクスは、半導体を用いて直流から交流、交流から直流への変換、電圧や電流、周波数を自在に制御する技術である。現在、風力発電や太陽光発電、鉄道や自動車、産業機械、家電製品など、電気エネルギーの発生・輸送・消費を効率的に行う上でのキーテクノロジーであり、生活に身近な様々なところに適用されている。(図表1-1)

図表1-1 電気エネルギーの発生・輸送・消費の流れ



また、パワーエレクトロニクスは適用する機器等の高性能化や省エネルギー化に大きく貢献し、更なる産業競争力の強化及び省エネルギー化を推進するためには、一層の性能向上による省エネルギー効果の増大に加え、技術を適用する用途や適用機器等の普及の拡大が必要であり、パワーエレクトロニクスに関連する技術の高度化は社会的な課題と言える。

このため、「パワー半導体等の技術に関する研究開発、普及の推進」や「パワーエレクトロニクスによる電力制御等のエネルギー利用の革新を目指した研究開発」を推進することは、「科学技術基本計画(平成23年8月19日 閣議決定)」において、グリーンイノベーションの推進という目標達成のための重点的に推進する施策のひとつに位置づけられている。また、「日本再興戦略(平成25年6月14日 閣議決定)」においては、「2020年までに新材料等による次世代技術の本格的な事業化を目指す」とされており、現在、経済産業省において、パワーデバイスの高度化のための研究開発プロジェクトやパワーエレクトロニクス適用機器の普及のための施策等が実施されている。

現在、Si(ケイ素/シリコン)を材料とするパワーデバイスによるパワーエレクトロニクスが上述のとおり、広く社会実装されている。一方、Siではない新材料や次世代材料としてSiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)があり、物質の特性上、Siよりも電力損失が少ないなどとされるSiCをパワーデバイスとして実用化する研究開発がこれまで進められており、このパワーデバイスを適用したパワーエレクトロニクス機器(インバータ)が鉄道に試験的に適用、その省エネルギー効果を実証されるなど実用化・事業化がされ始めている。また、高周波特性に優れるGaNは、通信機器用電源などへの応用が期待されている。

これまでSiCやGaNを中心にパワーデバイスとして実用化するための研究開発が国家プロジェクトとして進められてきたが、これら材料の本来の性能を発揮したデバイスを実用化するためには、半導体結晶の欠陥密度低減やウエハの大口径化に加え、デバイスの特徴を生かすモジュールや回路技術など基盤的な技術開発にも多くの課題が残されている。

一方、世界的には、欧州、米国、アジア諸国でも、次世代のパワーエレクトロニクスに関する研究開発が推進されている。特に、欧州では、応用面での課題抽出を軸に、パワーモジュール(パワーデバイスをモジュール化したもの)を中心とする実用化研究開発が、産学の密接な連携体制の基に推進されている。そのほかにも、現状、8 インチ(約 200mm)ウエハで生産されている Si-MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) パワーデバイスを、12 インチ(約 300mm)ウエハで生産することが発表され、オープンベーション施設では GaN パワーデバイスに関する研究開発を強化する流れがある。また、米国では先端技術によるものづくりや軍事技術への展開を目的として研究開発が進められ、さらに本年にはノースカロライナ州立大学を中心にワイドバンドギャップ(WBG)パワーデバイスをテーマとする産学協同の拠点構築が進めることが表明された。加えて、中国、韓国、台湾は技術力向上によって日本を猛追しており、SiC によるパワー半導体実用化に向けた国家プロジェクトが立ち上げられている。

なお、マーケットに目を転じると、パワーエレクトロニクス関連の世界市場規模は着実に成長しており、2030 年には 20 兆円に拡大すると見込まれている。

(2) 意義・政策的な重要性

このような状況を踏まえると、現在主流材料である Si パワーデバイスの領域において日本企業が多くのシェアを占めているため国際競争力に優位性があるが、新材料を用いる次世代技術でも先んじなければ後塵を拝すことが懸念される。

将来的に大きな成長が見込まれている市場分野は、産業機器、自動車及び電力用機器と見られ、これらの分野で、今後も上位シェアを維持・拡大し、日本の競争力を不動のものとすることは極めて重要である。

また、自動車や電力機器は社会基盤を支えるものであり、これらに次世代パワーエレクトロニクスを適用することは国際競争力を高める上で重要である。これらの分野は、他に比してより高いレベルの性能と信頼性が必要とされる上に、製品化への検証に長期間を要するため、その開発は戦略的に進める必要がある。

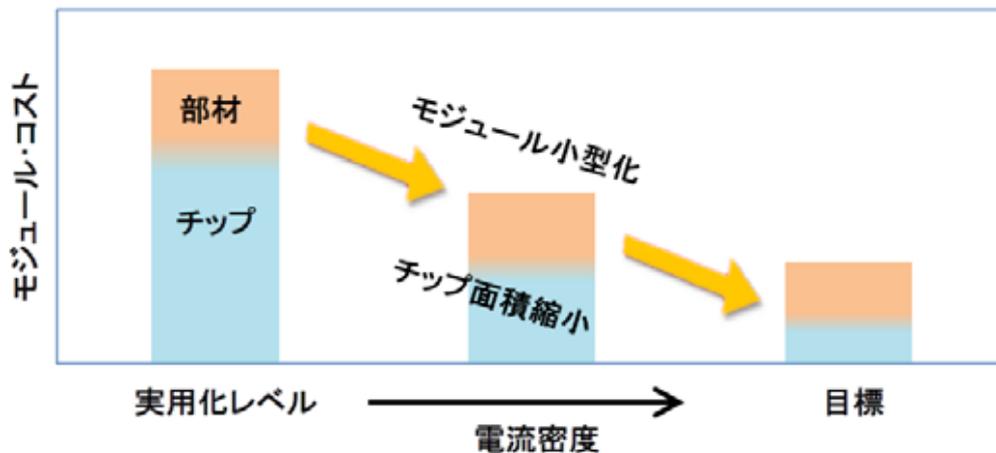
特に、SiC デバイスは、1kV を超えると耐圧の増加に伴い導通損失(抵抗率)が増大する傾向にあり、6.5kV 以上ではブレイクスルーのためにデバイス構造を見直すことが必要であり、SJ(Super Junction)-MOS やバイポーラデバイス(IGBT)などが有望であり、これらの実用化が必要である。

また、大きな将来性が見込まれる自動車(HEV、EV/FCV)・産業用途向けに次世代パワーエレクトロニクスを大きく普及させるためには、信頼性の確保はもちろんのことモジュールを高電流密度化することによる超小型化・軽量化が有効な手段である(図表1-2)。同時に接合や放熱など実装技術の高度化を図ることも重要である。

また、次世代パワーデバイスは、現用のものに比べて格段に低損失で高速に動作する特徴があるので、パワーデバイスの単純な置き換えで、ある程度、小型・軽量・高効率のパワーエレクトロニクス機器の実現は期待できる。しかしながら、次世代パワーデバイスの特性を十二分に活かした競争力の高い革新的な機器の実現ためには、モジュールや回路構成、制御や保護技術などの使いこなし技術と応用技術開発や周辺技術の研究開発が必須である。これらの分野の研究は我が国においても海外においても未だ緒に就いたばかりであり、いち早く着手し強化することが必要である。

特に、今後拡大が期待されている電力機器応用において必要となる技術課題を把握し、これらを克服してモデル検証まで行うことが重要である。

図表1-2 高電流密度化によるモジュールコスト低減のイメージ



また、さらに1歩先、2歩先の先進的な技術の開発にも取り組むことにより、継続的な革新技術を推進することが重要と考えられる。

スイッチング特性で SiC を上回るとされる GaN は、海外で盛んに研究開発が進められており、国際競争力の観点から GaN の追究も同時に進めなければならない。しかし、GaN は、ウエハの品質が安定していない課題があり、パワー半導体としての実用化研究は萌芽的である。現在、Si 基板上に GaN 薄膜をエピタキシャル成長させた小容量の 1kV 級横型 GaN パワーデバイスの実用化が開始されている。これは、GaN の高速スイッチング動作による半導体デバイスや適用機器の小型化を主に狙ったものである。GaN の特性を十二分に引き出し、高信頼化や大容量化を図るには、GaN ウエハ上に GaN 薄膜をエピタキシャル成長させた縦型パワー半導体を実現することが有望視されているが、世界的に見ても、この技術の成果は未だ検証されていない。一方、GaN は LED 作製基板として現在広く普及し始めているが、更なる高輝度 LED に適用するもので、かつパワーデバイスにも適用可能性を持つ GaN ウエハの作成が試みられており、我が国において、前述の縦型パワーデバイスへの適用にフォーカスをあて、いち早く実用化を目指した取り組みをすることは重要となる。

これからも更なる技術革新を継続的に推進するためには、 Ga_2O_3 (酸化ガリウム) やダイヤモンドをはじめとする優れた物性値を有する新材料の探索とパワー半導体への応用開発や、従来にない概念の新構造デバイスや新回路等による究極のパワーエレクトロニクスの実現に向けた取り組みも重要である。

(3) 目標・狙い

①社会的目標

2020 年までにパワーエレクトロニクス技術を駆使した超高効率なエネルギー利用により、かつてないほどの省エネ効果を達成する。また、同年、盛夏の中開催される東京オリンピック・パラリンピック等で、その省エネ効果や新たなエネルギー利用の形を世界にアピールする。

②産業面の目標

パワーエレクトロニクスに関係する技術の高度化を推進し、適用用途の拡大や普及拡大、性能向上による省エネ効果の増大等を図り、今後一層の産業競争力の強化及び省エネ化を推進する。

関連市場規模の拡大傾向の中、革新的なパワーエレクトロニクス機器・システムを構築できる差別化技術を確認する。あわせて次世代パワーデバイスの新しい適用技術、システム開発を推進するシステム

インテグレータを育成することにより、日本企業の世界シェアを維持・拡大する。国際競争での新たな“勝ちパターン”を創出すると共に、これらを支える人材育成メカニズム、多様な人材がリーダーシップを発揮できる環境の構築を図る。

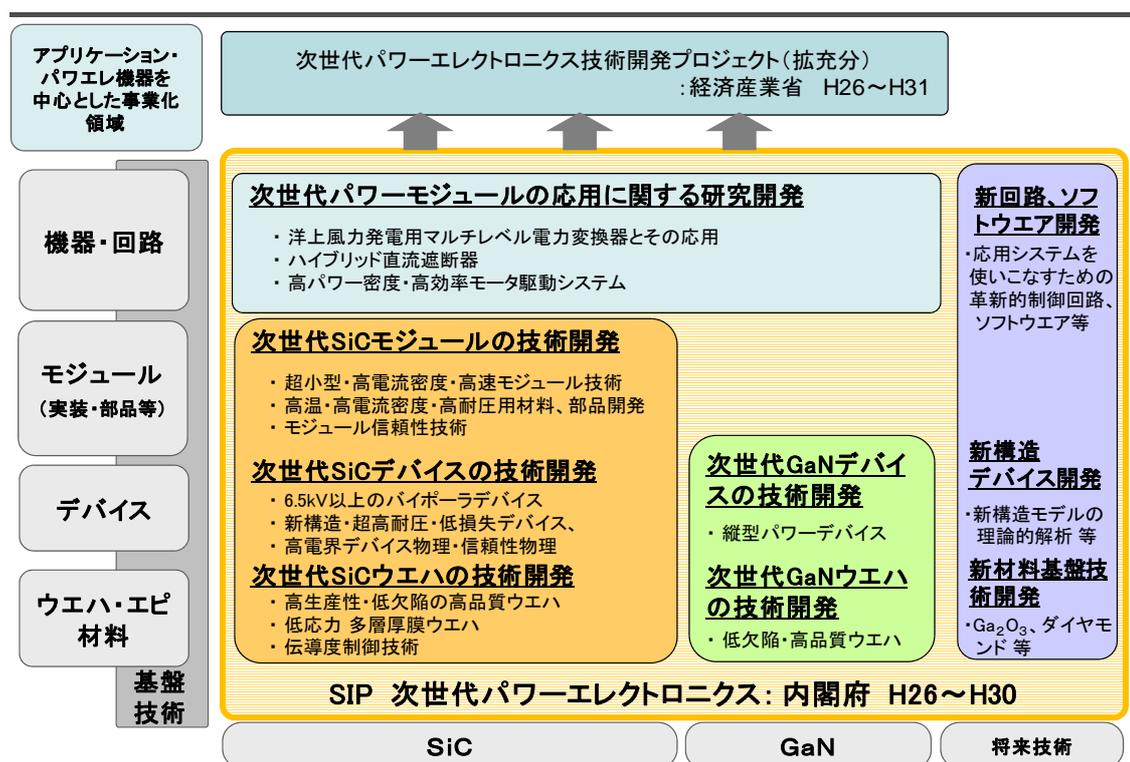
③技術的目標

上述の社会的目標及び産業面の目標に向けた取り組みとして、本プロジェクトでは、次世代パワーエレクトロニクス技術のさらなる適用領域の拡大や普及促進のため、超高耐圧デバイス技術と次世代デバイスの特性・優位性を活かすためのモジュールや回路構成、制御や応用技術、周辺技術を強化し、高付加価値を生むことを目標とする。特に、次世代電力用や次世代自動車・産業用などのパワーエレクトロニクス機器実現に必要な高電圧・大電流電力変換機や超小型・高電流密度・高速電力変換機を実現するためのウエハ、デバイスから回路までの各技術を一気通貫に連携させて研究開発する。

2. 研究開発の内容

図表2-1に本プロジェクトに係る次世代パワーエレクトロニクス研究開発の全体像を示し、各研究開発項目について詳述する。

図表2-1 次世代パワーエレクトロニクス研究開発の全体像



研究開発項目 I SiC に関する拠点型共通基盤技術開発

(1) 研究開発の必要性

SiC パワーエレクトロニクスは、鉄道、民生機器に採用される等、一部実用化が進みつつあるが、その適用範囲は未だ限定的である。今後、単なる Si の置き換えではない SiC 独自の市場に適用範囲を拡大するためには、更なる高耐圧化、小型化、低損失化を信頼性の確保とともに実現することを可能とする SiC パワーエレクトロニクスの基盤研究を更に強化する取り組みが重要となる。

(2) 研究開発の具体的内容

SiC パワーエレクトロニクスの基盤技術を強化するため、産学連携の研究開発拠点を構築し、以下の研究開発に取り組むと共に、関連の研究者等の人材育成を達成する。また、ウエハ、デバイス等の各段階において、隣接する階層との相互のフィードバックを構築することにより、性能向上等を図ることとする。

なお、ここでいう「拠点」とは、中心となる機関のもと、関係機関がネットワークを構築する等により、目標達成に向けて効率的に研究開発を推進する体制のことを指す。

① 次世代 SiC ウエハの技術開発

高耐圧性、低抵抗性、信頼性に優れたパワーデバイスに供する SiC ウエハ実現のため、昇華法に加えて各種の結晶成長法、結晶加工法を駆使して、バイポーラデバイスにも対応できる低応力の多層厚膜ウエハ作製技術、Si で実現されているような低抵抗化／高抵抗化のためのウエハ伝導度制御技術の開発を行う。

また、それらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

② 次世代 SiC デバイスの技術開発

SiC パワーデバイスの低損失性を保ったままスイッチング動作を 6.5kV 以上の領域に拡大するため、従来のユニポーラ動作デバイスとは異なるバイポーラ動作デバイスを開発する。

3kV 以上の耐圧領域における SiC パワーデバイスを、より低損失化、高電流密度化、高速化させるため、従来のプレーナ型やトレンチ型 MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) とは異なる新構造デバイスや高機能デバイスを開発する。

また、それらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

同構造を用いた 100A 級パワーデバイスのスイッチング試験を行う。更に、同構造デバイスの動作原理の詳細及び用いたウエハ品質との関連を明らかにする。

・低損失高速動作に向けた SiC ユニポーラ動作デバイスとして、6.5kV 以上の耐圧と 1V 以下のオン電圧 (100A/cm²、室温にて) を持つ新構造のパワーデバイスを実現する。また、関連モジュール化技術と併せ、同構造を用いた 100A 級パワーデバイスのスイッチング試験を行う。更に、同構造デバイスの動作原理の詳細及び用いたウエハ品質との関連を明らかにする。

③ 次世代 SiC モジュールの技術開発

次世代パワーデバイスが持つ優れた性能を活用するため、モジュールの電気・熱・機械の各現象を精密に把握しモデル化を行い、モジュールの信頼性評価手法を開発する。また、それらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

モジュール化技術においては、素子開発で先行する1kV級耐圧のSiCパワーデバイスを利用する高電流密度型モジュールの開発を行い、超小型・高電流密度・高速モジュールの実現を目指す。

併せて、モジュール実現に必要な高温・高電流密度に耐える受動素子、周辺材料と高耐圧用の受動素子、周辺材料開発を行う。

また、それらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

研究開発項目Ⅱ GaNに関する拠点型共通基盤技術開発

(1) 研究開発の必要性

SiCパワーデバイスは一部実用化が進みつつあるが、物性に優れるGaNはGaNウエハの品質がパワーデバイスに必要なレベルに達しておらず、パワーデバイスの開発に十分に取り組むことができていない。他方、米国等の海外では、GaNのパワーデバイス関連の研究に国家プロジェクトとして取り組み始めている等、日本と比較してGaNへの研究開発投資は先行している。

日本は、パワーエレクトロニクス関連の応用開発や光用途でのGaNヘテロエピ技術に強みを持っており、GaNのパワーエレクトロニクスで世界を先導するポテンシャルを有している。そのポテンシャルを発揮し、世界を牽引するためには、GaNウエハ及びデバイスの高品質化が鍵となっている。

(2) 研究開発の具体的内容

GaNパワーエレクトロニクスの基盤技術を強化するため、産学連携の研究開発拠点を構築し、以下の研究開発に取り組むと共に、関連の研究者等の人材育成を達成する。また、ウエハ、デバイス等の各段階において、隣接する階層との相互のフィードバックを構築することにより、性能向上等を図ることとする。

なお、ここでいう「拠点」とは、中心となる機関のもと、関係機関がネットワークを構築する等により、目標達成に向けて効率的に研究開発を推進する体制のことを指す。

①次世代GaNウエハの技術開発

低欠陥で、パワーデバイスに供するGaNウエハ実現のための革新的製造技術を開発する。

また、それらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

②次世代GaNデバイスの技術開発

GaNの縦型パワーデバイス実現に必要なプロセスを開発し、パワーデバイス性能のポテンシャルを検証する。

また、それらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

研究開発項目Ⅲ 次世代パワーモジュールの応用に関する基盤研究開発

(1) 研究開発の必要性

SiC、GaN等の材料に依らず、次世代パワーエレクトロニクスの活用を更に推進するためには、次

世代パワーデバイスやモジュールの特徴を活かして、性能を最大限に引き出すための回路や制御、保護技術などの使いこなし技術の研究開発と、次世代パワーモジュールを新規応用分野に展開するための応用技術開発や周辺技術開発を推進して活用の幅を広げることが重要となってくる。従って、次世代パワーデバイス、モジュールを用いた小型・軽量な高効率・高性能電力変換システムとその応用の研究開発推進が鍵となり、そのための基盤技術確立、成果の実証等が必要となってくる。

(2) 研究開発の具体的内容

次世代パワーモジュールの使いこなしを推進し、活用の幅を広げるために、次世代パワーモジュールを用いた高効率・高性能電力変換システムや高パワー密度・高効率モータ駆動システムとその応用(絶縁型 DC/DC コンバータ、遮断器、低圧 PWM インバータ、高圧マルチレベルインバータ等)を実現するために必要な各種回路(制御回路、駆動回路、保護回路等)の開発を行う。

また、応用システムの最適設計を可能にするシミュレーション技術等を開発することにより、パワーモジュールと上記電力変換・応用システムとの効率的な集積化を行うと共に、応用製品の試作及び動作実証を行う。

また、それらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

なお、研究開発項目Ⅲは、必要に応じて研究開発項目Ⅰ、Ⅱの成果を活用する等、他の研究開発項目と連携して実施するものとする。

研究開発項目Ⅳ 将来のパワーエレクトロニクスを支える基盤研究開発

(1) 研究開発の必要性

現在、相対的に安価な Si パワーデバイスの普及は進んでいるが、その適用範囲を更に拡大するためには、性能と安全動作領域とのトレードオフの解決や動作定格の改善など、高性能化に向けた新機軸の研究開発が必要となる。

また、SiC や GaN を用いたパワーデバイスよりも更に高性能なパワーデバイスを実現するためには、 Ga_2O_3 (酸化ガリウム)やダイヤモンドをはじめとする優れた物性値を有する新材料の開拓が不可欠である。

将来に渡ってパワーエレクトロニクスを日本が牽引するためには、パワーエレクトロニクスに関する産学の新しい知を結集し、10~15年後の実用化を目指した研究開発を実施し、新材料、新構造、新回路等による究極のパワーエレクトロニクスを実現することが重要となってくる。

(2) 研究開発の具体的内容

例えば、 Ga_2O_3 、ダイヤモンドといったパワーエレクトロニクスの材料として物性値に優れている材料によるウエハ、デバイス、モジュールの作製、材料を問わず性能向上に繋がる微細化等を追求した新構造デバイスの開発、パワーエレクトロニクスシステムと電力システムの連携を図る回路、ソフトウェアの開発等、従来のパワーエレクトロニクスの概念に縛られないアプローチにより、革新的な性能向上に資する基礎的な領域の研究を行う。

なお、本研究開発項目では、中間評価の結果等に基づいて、プロジェクトの後半は研究開発テーマを絞り込んで実施する。

① 新材料基盤技術開発

Si、SiC 及び GaN を除く次世代パワーデバイス向け材料に関して、結晶の欠陥制御技術、高純度バルク結晶作製技術等を開発し、安定的に品質の高い新材料ウエハ、デバイス、モジュール等の作製を可能とする技術開発、並びにそれらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

② 新構造デバイス開発

材料を問わず、新構造モデルの理論的解析等を通じて、高性能化を可能とする新しいデバイス構造に関する技術開発、並びにそれらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

③ 新回路、ソフトウェア開発

電カシステムとの連携を図る等によりパワーエレクトロニクスの応用システムの使いこなしを推進するような、パワーエレクトロニクスシステムに付随する革新的な制御回路やソフトウェア等の開発、並びにそれらに資する関連評価技術や学術的基盤技術の開発を行う。

また、関連する企業、大学等の関係者と共に、関連技術、関連市場等のベンチマークを行い、テーマ毎に事業終了後から実用化に至るまでのロードマップを策定する。

図表2-4 工程表

	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度
研究開発項目 I SiC に関する拠点型 共通基盤技術開発	要素技術開発	連携要素技術開発		応用技術開発	プロト実証
研究開発項目 II GaN に関する拠点 型共通基盤技術開 発	研究開発 環境整備	要素技術開発		応用技術開発	プロト実証
研究開発項目 III 次世代パワーモジュ ールの応用に関す る基盤研究開発	研究開発 環境整備	要素技術開発		応用技術開発	プロト実証
研究開発項目 IV 将来のパワーエレク トロニクスを支える 基盤研究開発	技術検証と必要な要素技術開発			技術実証開発	絞り込み

(注)公募等により研究主体が確定した後、研究主体名を加筆する。

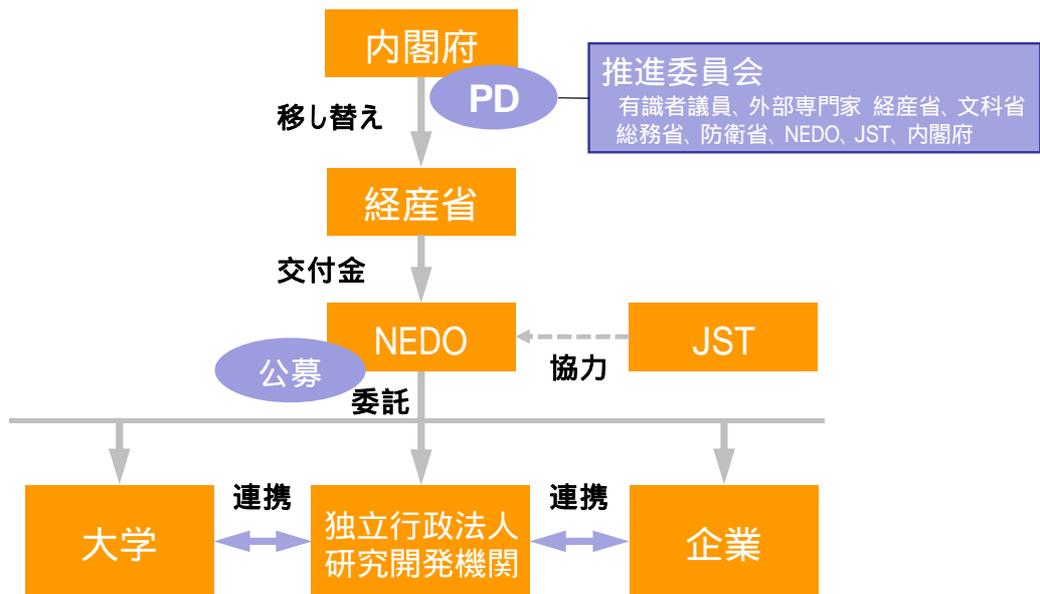
3. 実施体制

(1) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の活用

本件は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」という。)への交付金を活用し、図表3-1のような体制で実施する。

NEDO は、プログラムディレクターや推進委員会を補佐し、研究開発計画の検討、研究開発の進捗や予算の管理、自己点検の事務の支援、評価用資料の作成、関連する調査・分析などについて、(独)科学技術振興機構(以下「JST」という。)の協力も得て実施する。

図表3-1 実施体制



(2) 研究主体の選定

NEDOは、本計画に基づき、研究主体を公募により選定する。研究主体の選定審査の事務は、JSTの協力を得て、NEDOが行う。

審査基準や審査員等の審査の進め方は、JSTの協力を得て、NEDOがプログラムディレクター及び内閣府と相談し、決定する。審査には原則としてプログラムディレクター及び内閣府の担当官並びにJSTの担当職員も参加する。

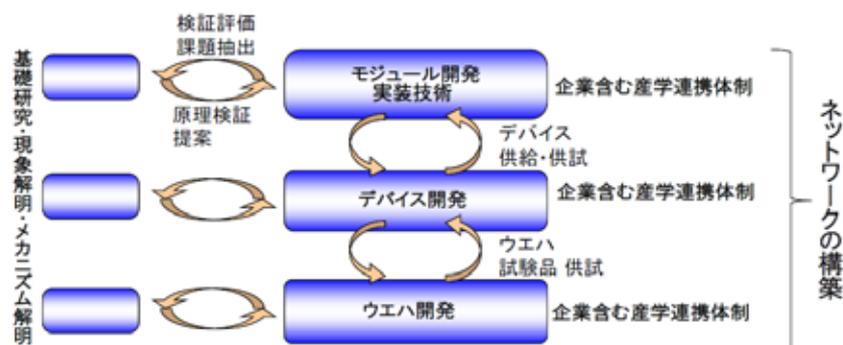
研究主体の利害関係者は当該研究主体の審査に参加しない。

公募により研究主体が決まった後、本計画に研究主体名等を加筆する。

(3) 研究主体を最適化する工夫

研究開発項目Ⅰ、Ⅱは、共同で研究を行う大学、研究機関、企業等から中心となる機関を設置し、関係機関が目標達成に向けてネットワークを構築する等により、効率的に研究開発を推進する「拠点」を設置し、必要に応じて大学、企業等の研究者が兼務・集結して研究を行う(図表3-2)。なお、研究開発項目Ⅰ、Ⅱは、ウエハ、デバイス等の各段階に原則として実用化を担う企業を含めることとし、実用化の主体を明確化する。

図表3-2 研究開発項目Ⅰ 研究体制概念図



研究開発項目Ⅲは、必要に応じて研究開発項目Ⅰ、Ⅱの成果を活用する等、他の研究開発項目と連携して実施するものとする。

研究開発項目Ⅳは、多種多様なアイデアの中から最適なものを選ぶため、「ステージゲート方式」を採用し、最初の3年間は多くのテーマを実施し、中間評価でテーマを絞り込んだ上で、後半の2年を実施する。

また、本プロジェクトの成果は、新材料パワーデバイスを用いたシステムの応用開発等を行う経済産業省の事業への橋渡し等により、早期の実用化・事業化へと導いてゆく。

なお、プログラムディレクターは、他省庁の事業も含めたパワーエレクトロニクスに関連する国の施策全体を俯瞰し、成果活用を含めた全体戦略を策定し、推進する。

4. 知財に関する事項

研究開発の成功と成果の実用化・事業化による国益の実現を確実にするため、優れた人材・機関の参加を促すためのインセンティブを確保するとともに、知的財産等について適切な管理を行う。

(1) 知財委員会

○知財委員会を NEDO に置く。

○知財委員会は、PD または PD の代理人、主要な関係者、専門家から構成し、本プロジェクト全体の知財方針を定める。

○知財委員会の担当範囲は、NEDO が執行する予算の範囲とする。

○研究開発成果に関する論文発表及び特許等(以下、「知財権」という。)の出願・維持等の方針決定については原則として研究主体で行うが、必要に応じ知財委員会で知財権の実施許諾に関する調整等を行う。

○知財委員会の詳細な運営方法等は NEDO において定める。

(2) 知財権に関する取り決め

○NEDO は、秘密保持、バックグラウンド知財権(研究責任者やその所属機関等が、プログラム参加する前から保有していた知財権)、フォアグラウンド知財権(プログラムで発生した知財権)の扱い等について、予め委託先との契約等により定めておく。

(3) バックグラウンド知財権の実施許諾

○他のプログラム参加者へのバックグラウンド知財権の実施許諾は、当該知財権者が定める条件に従い、知財権者が許諾可能とする。

○当該条件などの知財権者の対応が、SIP の推進に支障を及ぼすおそれがある場合、知財委員会において調整し、合理的な解決策を得る。

(4) フォアグラウンド知財権の取扱い

○フォアグラウンド知財権は、原則として産業技術力強化法第 19 条第 1 項を適用し、発明者である研究責任者の所属機関(委託先)に帰属させる。

- 再委託先等が発明し、再委託先等に知財権を帰属させる時は、知財委員会による承諾を必要とする。その際、知財委員会は条件を付すことができる。
- 知財権者に事業化の意志が乏しい場合、知財委員会は、積極的に事業化を目指す者による知財権、実施権の保有を推奨する。
- 参加期間中に自らの意志で脱退する者は、当該参加期間中にSIPの事業費により得た成果(複数年度参加していた場合には、参加当初からの全ての成果)の全部または一部に関して、脱退時に NEDO が無償譲渡させること及び実施権を設定できることとする。
- 知財権の出願・維持等にかかる費用は、原則として知財権者による負担とする。共同出願の場合は、持ち分比率、費用負担は、共同出願者による協議によって定める。

(5) フォアグラウンド知財権の実施許諾

- 他のプログラム参加者へのフォアグラウンド知財権の実施許諾は、知財権者が定める条件に従い、知財権者が許諾可能とする。
- 第三者へのフォアグラウンド知財権の実施許諾は、プログラム参加者よりも有利な条件にはしない範囲で知財権者が定める条件に従い、知財権者が許諾可能とする。
- 当該条件などの知財権者の対応が、SIP の推進に支障を及ぼすおそれがある場合、知財委員会において調整し、合理的な解決策を得る。

(6) フォアグラウンド知財権の移転、専用実施権の設定・移転の承諾について

- 産業技術力強化法第 19 条第 1 項第 4 号に基づき、フォアグラウンド知財権の移転、専用実施権の設定・移転の承諾には、合併・分割による移転の場合や子会社・親会社への知財権の移転、専用実施権の設定・移転の承諾をする場合等(以下、「合併等に伴う知財権の移転等の場合等」という。)を除き、NEDO の承認を必要とする。
- 合併等に伴う知財権の移転等の場合等には、知財権者は NEDO との契約に基づき、NEDO の承認を必要とする。
- 移転後であっても当該実施権を NEDO が保有可能とする。当該条件を受け入れられない場合、移転を認めない。

(7) 終了時の知財権取扱いについて

- プログラム終了時に、保有希望者がいない知財権については、知財委員会において対応(放棄、あるいは、NEDO による承継)を協議する。

(8) 国外機関等(外国籍の企業、大学、研究者等)の参加について

- 当該国外機関等の参加が課題推進上必要な場合、参加を可能とする。
- 適切な執行管理の観点から、研究開発の受託等にかかる事務処理が可能な窓口または代理人が国内に存在することを原則とする。
- 国外機関等については産業技術力強化法第 19 条第 1 項を適用せず、知財権は NEDO と外国機関等の共有とする。

5. 評価に関する事項

(1) 評価主体

PD と NEDO 等が行う自己点検結果の報告を参考に、ガバニングボードが外部の専門家等を招いて行う。この際、ガバニングボードは分野または課題ごとに開催することもできる。

(2) 実施時期

- 事前評価、毎年度末の評価、最終評価とする。
- 終了後、一定の時間(原則として3年)が経過した後、必要に応じて追跡評価を行う。
- 上記のほか、必要に応じて年度途中等に評価を行うことも可能とする。

(3) 評価項目・評価基準

「国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成24年12月6日、内閣総理大臣決定)」を踏まえ、必要性、効率性、有効性等を評価する観点から、評価項目・評価基準は以下のとおりとする。評価は、達成・未達の判定のみに終わらず、その原因・要因等の分析や改善方策の提案等も行う。

- ①意義の重要性、SIPの制度の目的との整合性。
- ②目標(特にアウトカム目標)の妥当性、目標達成に向けた工程表の達成度合い。
- ③適切なマネジメントがなされているか。特に府省連携の効果がどのように発揮されているか。
- ④実用化・事業化への戦略性、達成度合い。
- ⑤最終評価の際には、見込まれる効果あるいは波及効果。終了後のフォローアップの方法等が適切かつ明確に設定されているか。

(4) 評価結果の反映方法

- 事前評価は、次年度以降の計画に関して行い、次年度以降の計画等に反映させる。
- 年度末の評価は、当該年度までの実績と次年度以降の計画等に関して行い、次年度以降の計画等に反映させる。
- 最終評価は、最終年度までの実績に関して行い、終了後のフォローアップ等に反映させる。
- 追跡評価は、各課題の成果の実用化・事業化の進捗に関して行い、改善方策の提案等を行う。

(5) 結果の公開

- 評価結果は原則として公開する。
- 評価を行うガバニングボードは、非公開の研究開発情報等も扱うため、非公開とする。

(6) 自己点検

①研究責任者による自己点検

PD が自己点検を行う研究責任者を選定する(原則として、各研究項目の主要な研究者・研究機関を選定)。

選定された研究責任者は、5.(3)の評価項目・評価基準を準用し、前回の評価後の実績及び今後の

計画の双方について点検を行い、達成・未達の判定のみならず、その原因・要因等の分析や改善方策等を取りまとめる。

②PDによる自己点検

PDが研究責任者による自己点検の結果を見ながら、かつ、必要に応じて第三者や専門家(下記)の意見を参考にしつつ、5.(3)の評価項目・評価基準を準用し、PD自身、NEDO及び各研究責任者の実績及び今後の計画の双方に関して点検を行い、達成・未達の判定のみならず、その原因・要因等の分析や改善方策等を取りまとめる。その結果をもって各研究主体等の研究継続の是非等を決めるとともに、研究責任者等に対して必要な助言を与える。これにより、自律的にも改善可能な体制とする。

これらの結果を基に、PDはNEDOの支援を得て、ガバニングボードに向けた資料を作成する。

6. 出口戦略

(1) 戦略及びシナリオの検討・策定とプロト機による要求性能の実証

- ・市場調査、技術動向調査の結果等を基に、関連する有識者等の知見を取り入れ、パワーエレクトロニクスによる新たな産業・市場の創出から、どのような社会を目指すのか等、その戦略及びシナリオを検討・策定する。
- ・新たな産業・市場となるアプリケーション・機器については、求められる機能からバックキャストした性能・仕様を見定め、必要に応じて研究開発計画に反映する。
- ・バックキャストした性能・仕様を満足できる技術が開発できたことを、機器のプロト機を試作し、性能・品質・生産性での優位性を具体的に示して産業界での製品化開発を推進する。
(例えば、洋上風力発電用マルチレベル電力変換器等を想定)

(2) 標準化・性能認証制度や省エネトップランナー基準による成果普及

- ・パワーモジュールやモジュール構成部材・構成要素の加速劣化試験や寿命推定試験等の性能評価に関し、関係機関で最適な標準的試験方法等を検討する。
- ・性能評価指標と試験標準の検討を行って、競争力を確保することを担保した標準化を推進する。
- ・市場品質の確保とそれによる市場拡大を図るため、標準的試験方法等により、デバイス、モジュール、パワーエレクトロニクス用部品・材料の性能認証制度検討を推進する。
- ・省エネトップランナー基準を活用し、対象機器の追加に加え、システムとしても対象化を目指す。